

INS/11:35/4A.F

PROGRAMADOR E CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA FORNOS RESISTIVOS COM RESOLUÇÃO DE $0,1^{\circ}\text{C}$. Gessé Eduardo Calvo Nogueira, Sonia Licia Baldochi e Spero Penha Morato. (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN/CNEN/SP).

Desenvolveu-se um sistema destinado a programação e controle de temperatura para fornos resis-
tivos normalmente utilizados em crescimento de cristais. O controle de temperatura possui resolu-
ção de $0,1^{\circ}\text{C}$ para faixa de 0 a $999,9^{\circ}\text{C}$, e a estabilidade é de $0,04^{\circ}\text{C}$ e apresenta "Over Shut" infe-
rior a 0,5% para degraus de 50% da potência máxima. O sistema de controle baseia-se na correção do
sistema pela aproximação por um sistema de segunda ordem, dispondo de controles de banda propor-
cional, integrador e derivador.